

# NR26 25000P光刻胶报价 赛米莱德

产品名称	NR26 25000P光刻胶报价 赛米莱德
公司名称	北京赛米莱德贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区博兴九路2号院5号楼2层208
联系电话	15201255285 15201255285

## 产品详情

NR77-20000P

正胶PR1-2000A1技术资料

正胶PR1-2000A1是为曝光波长为365 或者436纳米，可用于晶圆步进器、扫描投影对准器、近程打印机和接触式打印机等工具。PR1-2000A1可以满足对附着能力较高的要求，NR26 25000P光刻胶报价，在使用PR1-2000A1时一般不需要增粘剂，如HMDS。

相对于其他的光刻胶，NR26 25000P光刻胶哪里有，PR1-2000A1有如下的一些额外的优势：

PEB，不需要后烘的步骤；

较高的分辨率；

快速显影；

较强的线宽控制；

蚀刻后去胶效果好；

在室温下有效期长达2年。

NR9-3000PYNR26 25000P光刻胶

光刻胶底膜处理：清洗：清洁干燥，NR26 25000P光刻胶价格，使硅片与光刻胶良好的接触。烘干：去除衬底表面的水汽，使其干燥，增粘处理(涂底)：  
涂上增加光刻胶与硅片表面附着能力的化合物，HMDS，光刻胶疏水，SiO<sub>2</sub> 空气中，Si-OH，表面有，亲水性，使用HMDS (H<sub>2</sub>C) 6Si<sub>2</sub>NH 涂覆，熏蒸与 Si-OH 结合形成 Si-O-Si(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>，与光刻胶相亲。

## 美国Futurrex的光刻胶

北京赛米莱德贸易有限公司供应美国Futurrex新型lift-off光刻胶NR9-3000PY，NR26 25000P光刻胶，此款负胶的设计适用于比较宽的波长范围和i线（366纳米）曝光工具。当显影后显示出负的侧壁角度，是lift-off工艺中比较简易的光刻胶。和其他胶相比NR9i-3000PY有下面的优势：1.

比较高的光刻速度，可以定制光刻速度来曝光产量 2. 比较高的分辨率和快的显影时间 3.

根据曝光能量可以比较容易的调整侧壁角度 4. 耐温可以达到100摄氏度 5. 用RR5去胶液可以很容易的去胶 NR9-3000PY的制作和工艺是根据职业和环境的安全而设计。主要的溶剂是，NR9-3000PY的显影在水溶液里完成。属固含量（%）：31-35 主要溶剂：外观：浅液体涂敷能：均匀的无条纹涂敷

100摄氏度热板烘烤300秒后膜厚涂敷自旋速度 40秒自旋。

NR26 25000P光刻胶报价-赛米莱德由北京赛米莱德贸易有限公司提供。

北京赛米莱德贸易有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京 大兴区 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。赛米莱德带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！